

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ**Cu-Sn-TiO₂ ИЗ СУЛЬФАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА**

Электрохимические нанокомпозитные покрытия с равномерно распределенными наночастицами инертной фазы в большинстве случаев обладают повышенной микротвердостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью и другими улучшенными функциональными свойствами, обеспечивающими перспективность их использования в различных областях техники.

Сплавы меди с оловом, более известные как оловянистые бронзы, вследствие их привлекательного внешнего вида и достаточно высокой коррозионной устойчивости широко используются в качестве защитных и декоративных покрытий. Кроме того, покрытия сплавами Cu–Sn являются альтернативой никелевым покрытиям, продукты коррозии которых при контакте с кожей человека могут вызывать развитие контактных дерматитов [1].

Целью данной работы является электрохимическое получение композиционных покрытий Cu-Sn-TiO₂ из сульфатного электролита, а также изучение физико-механических свойств, морфологии, качественного и количественного состава формируемых покрытий.

В качестве базового использовали электролит следующего состава, г/дм³: CuSO₄·5H₂O — 40, SnSO₄·H₂O — 40, H₂SO₄ — 100. Инертной фазой служил TiO₂ (модификация – анатаз) с размерами частиц 50–200 нм. Содержание TiO₂ в электролите варьировали от 1 до 10 г/дм³. Осаждение покрытий проводили в потенциостатическом режиме при потенциале –0,04 В. Состав и морфологию формируемых покрытий исследовали при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-5610 LV, оснащенного системой химического анализа EDX JED-2201 JEOL. Для определения содержания TiO₂ в составе покрытия использовали волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр PANalytical Axios. Микротвердость полученных покрытий исследовали при помощи оптического микроскопа–твёрдомера AFRI-MVDM8.

Введение в электролит наночастиц диоксида титана в количестве от 1 до 10 г/дм³ приводит к формированию покрытий Cu-Sn-TiO₂ с ярко выраженным дендритами и кристаллитами сферической формы. Формирование более неоднородных покрытий по сравнению с покрытиями, полученными из электролита, не содержащего частицы дисперской фазы, обусловлено включением крупных агломератов TiO₂ в матрицу сплава, что способствует неоднородному росту покрытий на различных микроучастках катода. Увеличение концентрации TiO₂ в исследуемом электролите от 1 до 10 г/дм³ приводит к росту его содержания в матрице сплава от 0,17 до 1,51 масс.%.

Из электролита, не содержащего дисперсную фазу TiO₂, формируются покрытия Cu–Sn с микротвердостью 270 HV. Введение в раствор от 1 до 10 г/дм³ частиц TiO₂ приводит к формированию покрытий Cu–Sn–TiO₂ с микротвердостью от 300 до 320 HV соответственно. Увеличение микротвердости покрытий при введении в электролит TiO₂, по-видимому, объясняется так называемым эффектом дисперсионного упрочнения. Дисперсионное упрочнение обусловлено распределением в металлической матрице частиц TiO₂, которые препятствуют движению дислокаций в структуре сплава, что, в свою очередь, приводит к возрастанию микротвердости покрытий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Касач, А. А. Электроосаждение сплава Cu-Sn из щавелевокислого электролита в присутствии аминосодержащих поверхностно-активных веществ / А. А. Касач, Д. С. Харитонов, В. И. Романовский, Н. М. Кузьменок, И. М. Жарский, И. И. Курило // Журнал прикладной химии. – 2019. – Т. 92. – №. 6. – С. 793–799.